

Спосіб контролю висотних відміток деформаційних марок, що ґрунтується на фотоелектричній реєстрації відносного положення трьох суміжних марок, який **відрізняється** тим, що фотоелектричний вимірювальний прилад (ФЕП) з'єднують з посадковою конструкцією деформаційної марки, світлові випромінювачі з'єднують також з сусідніми по обидва боки від ФЕП деформаційними марками, а світлові потоки від світлових випромінювачів направляють в об'єктив ФЕП і вимірюють різницю кутових відхилень зображень світлових випромінювачів в полі зору ФЕП, потім ФЕП переставляють на сусідню марку за напрямом нівелірного ходу, а світлові випромінювачі переставляють також на сусідні по ходу марки і виконують вимірювання, аналогічне попередньому, далі повторюють описані операції по всьому нівелірному ходу, а за отриманими різницями кутових відхилень зображень світлових випромінювачів на всіх деформаційних марках, включаючи марки на опорних реперах, розраховують та зрівнюють значення висотних відміток деформаційних марок і порівнюють ці значення з отриманими у попередньому черговому циклі значеннями вимірів.